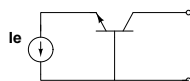


DE e DTE: PROVA SCRITTA DEL 22 Luglio 2014

ESERCIZIO 1 (DE,DTE) Un transistor n^+pn^+ (simmetrico, $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$, $W = 3 \mu\text{m}$, $S=10 \text{ mm}^2$), è polarizzato come in figura: $I_E = 1 \text{ mA}$, uscente. Trascurare l'ampiezza delle regioni di svuotamento per le giunzioni con $V > 0$.

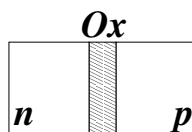


1) Determinare α_f , α_r , I_{ES} , I_{CS} (per queste ultime si può usare l'espressione valida per un diodo a base corta. NOTA: $V_{BC} > 0$, da verificare nel punto 2).[3]

2) Determinare V_{BC} . [4]

3) Determinare V_{BE} e V_{CE} . [3]

ESERCIZIO 2 (DE,DTE) Per il condensatore MOS in figura, la parte n è drogata con $N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, la parte p è drogata con $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 30 \text{ nm}$.



1) Calcolare la differenza di potenziale di contatto tra parte n e p e disegnare un diagramma di massima delle bande e del campo elettrico all'equilibrio ($V_{np} = 0 \text{ V}$). [4]

2) Per $V_{np} = 0 \text{ V}$ determinare le cadute nel silicio ψ_{sn} , ψ_{sp} e la caduta di potenziale nell'ossido (SUGGERIMENTO: carica totale nulla). [3]

3) Per $V_{np} = 5 \text{ V}$ (ben oltre la tensione di soglia) determinare ψ_{sn} , ψ_{sp} e la caduta di potenziale nell'ossido. [3]

ESERCIZIO 3 (DTE)

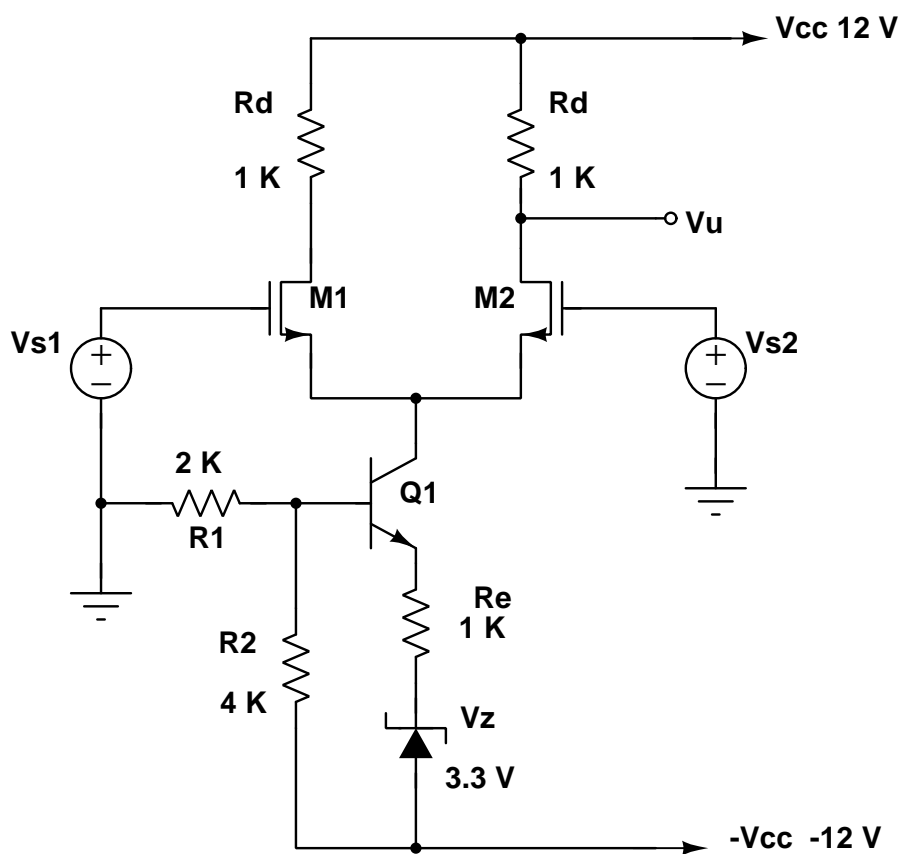
1) Descrivere i passi di processo necessari per la fabbricazione di una cella solare. [3]

2) Derivare una espressione per la corrente nella cella solare, in presenza di una G_{op} nota. [4]

3) Disegnare il circuito equivalente e la caratteristica $I - V$ di una cella solare, determinando graficamente la condizione di carico per la massima potenza in uscita. [3]

ESERCIZIO 4 (DE) Nel circuito in figura, il transistore bipolare ha $\beta_f \text{ minimo} = 300$, mentre M_1 e M_2 sono transistori n -MOS identici con gate in metallo ($N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $t_{ox} = 30 \text{ nm}$, $W/L = 20$). Per misurare la tensione di soglia, i transistori MOS sono stati caratterizzati con $V_{GS} = 5 \text{ V}$, ottenendo per basse V_{DS} una resistenza di quadro pari a $R_{quadro} = 2600 \Omega$.

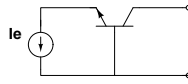
1) Determinare la funzione di lavoro del metallo.[4]



2) Calcolare il punto di riposo dei transistori e le correnti nel circuito.[4]

3) Determinare V_u per $V_{S1} = -12 \text{ V}$ in continua, verificando la polarizzazione dei transistori.[2]

ESERCIZIO 1 (DE,DTE) Un transistoro n^+pn^+ (simmetrico, $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 0.1 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $\tau_n = 10^{-6} \text{ s}$, $W = 3 \text{ }\mu\text{m}$, $S=10 \text{ mm}^2$), è polarizzato come in figura: $I_E = 1 \text{ mA}$, uscente. Trascurare l'ampiezza delle regioni di svuotamento per le giunzioni con $V > 0$.



1) Determinare α_f , α_r , I_{ES} , I_{CS} (per queste ultime si può usare l'espressione valida per un diodo a base corta. NOTA: $V_{BC} > 0$, da verificare nel punto 2).[3]

2) Determinare V_{BC} . [4]

3) Determinare V_{BE} e V_{CE} . [3]

SOLUZIONE 1

1) Calcoliamo i parametri:

$$D_n = \frac{kT}{q} \mu_n = 2.59 \times 10^{-3}$$

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} = 50.82 \quad \mu\text{m}$$

La giunzione base-emettitore è in diretta, poichè la corrente di emettitore è uscente, e $V_{BC} > 0$, quindi $W_{eff} = W$. Il transistoro è a base corta e, visto che è simmetrico, avremo:

$$\alpha_f = \alpha_r = \frac{1}{1 + \frac{W^2}{2L_n^2}} = 0.998265$$

$$I_{ES} = I_{CS} = qS \frac{D_n}{W} \frac{n_i^2}{N_A} = 31.1 \quad \text{pA}$$

2) Si può fare riferimento alle equazioni di Ebers-Moll:

$$I_E = -I_{ES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + \alpha_r I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$I_C = \alpha_f I_{ES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

Svolgendo alcuni semplici passaggi, simili a quelli necessari per ricavare la caratteristica di uscita a base comune, e imponendo $I_C = 0$, otteniamo (NOTA: I_E uscente, quindi negativa secondo le convenzioni dei segni usate nelle equazioni di EB):

$$I_C = -\alpha_f I_E - (1 - \alpha_f \alpha_r) I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$V_{BC} = V_T \ln \left(\frac{\alpha_f |I_E|}{(1 - \alpha_f \alpha_r) I_{CS}} + 1 \right) = 0.594 \quad \text{V}$$

3) Dalla prima equazione di Ebers-Moll otteniamo:

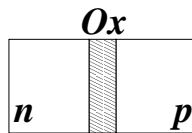
$$I_E = -I_{ES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + \alpha_r I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$I_{ES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) = I_E + \alpha_r I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$V_{BE} = V_T \ln \left(\frac{I_E + \alpha_r I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)}{I_{ES}} + 1 \right) = 0.594$$

Quindi la caduta di tensione $V_{CE} \simeq 0$.

ESERCIZIO 2 (DE,DTE) Per il condensatore MOS in figura, la parte n è drogata con $N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, la parte p è drogata con $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $t_{ox} = 30 \text{ nm}$.



1) Calcolare la differenza di potenziale di contatto tra parte n e p e disegnare un diagramma di massima delle bande e del campo elettrico all'equilibrio ($V_{np} = 0 \text{ V}$). [4]

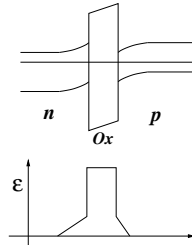
2) Per $V_{np} = 0 \text{ V}$ determinare le cadute nel silicio ψ_{sn} , ψ_{sp} e la caduta di potenziale nell'ossido (SUGGERIMENTO: carica totale nulla). [3]

3) Per $V_{np} = 5 \text{ V}$ (ben oltre la tensione di soglia) determinare ψ_{sn} , ψ_{sp} e la caduta di potenziale nell'ossido. [3]

SOLUZIONE 2

1) Qualitativamente, l'andamento delle bande all'equilibrio è come in figura, a causa della V_0 (o impropriamente ϕ_{MS}) dovuta alla differenza tra i livelli di Fermi del silicio n e p . Il campo elettrico è lineare (pendenza proporzionale al drogaggio, maggiore nella parte p) nel silicio, e costante nell'ossido. La discontinuità è pari al rapporto tra le costanti dielettriche. Avremo semplicemente:

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right) = 0.677 \quad \text{V} \quad (1)$$



Il campo elettrico ha una pendenza maggiore nella parte più drogata, è discontinuo all'interfaccia ossido-silicio, poiché il campo elettrico nell'ossido è circa 3 volte quello nel silicio, ed è costante nell'ossido.

2) Come in una struttura MOS, possiamo scrivere:

$$V_{np} = \psi_{sn} + \frac{|Q|}{C_{ox}} + \psi_{sp} - V_0 \quad (2)$$

Quindi all'equilibrio ($V_{np} = 0$) avemo:

$$V_0 = \psi_{sn} + \frac{|Q|}{C_{ox}} + \psi_{sp} \quad (3)$$

Questa equazione ha come incognite ψ_{sn} e ψ_{sp} . Una seconda equazione si può ottenere ricordando che la carica positiva nel silicio n deve essere uguale alla carica negativa nel silicio p :

$$|Q_n| = |Q_p|$$

$$\begin{aligned}\sqrt{2\epsilon_s q N_D \psi_{sn}} &= \sqrt{2\epsilon_s q N_A \psi_{sp}} \\ \psi_{sn} &= \frac{N_A}{N_D} \psi_{sp}\end{aligned}$$

Quindi l'equazione sopra si può riscrivere come:

$$V_0 = \frac{N_A}{N_D} \psi_{sp} + \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A \psi_{sp}}}{C_{ox}} + \psi_{sp} \quad (4)$$

Risolvendo questa equazione è possibile ottenere $\psi_{sp} = 0.159$ V. Quindi $\psi_{sn} = 0.318$ V e $V_{ox} = V_0 - \psi_{sn} - \psi_{sp} = 0.201$ V. In alternativa, possiamo calcolare $V_{ox} = \sqrt{2\epsilon_s q N_A \psi_{sp}} / C_{ox} = 0.201$ V.

3) Per $V_{np} > 0$ alla parte n vengono richieste cariche positive, e alla parte p cariche negative. Dato che siamo ben oltre la tensione di soglia (non è richiesta la verifica) sia la parte n che la parte p sono oltre l'inversione, per cui avremo:

$$\begin{aligned}\psi_{sn} &= 2\psi_{Bn} = 2V_T \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) = 0.658 \\ \psi_{sp} &= 2\psi_{Bp} = 2V_T \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) = 0.694\end{aligned}$$

La caduta nell'ossido risulta dunque $V_{ox} = V_{np} - \psi_{sn} - \psi_{sp} + V_0 = 4.32$ V.

ESERCIZIO 3 (DTE) 1) Descrivere i passi di processo necessari per la fabbricazione di una cella solare. [3]

2) Derivare una espressione per la corrente nella cella solare, in presenza di una G_{op} nota. [4]

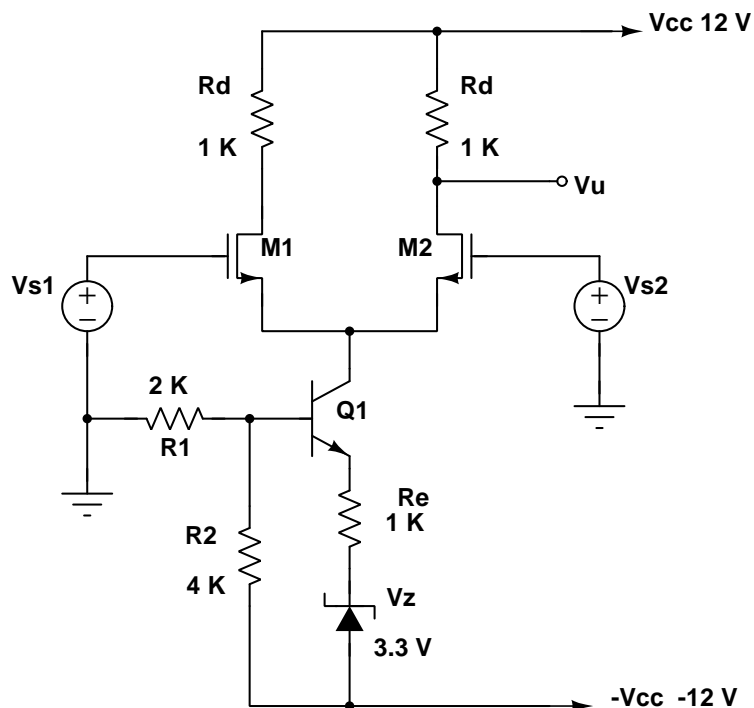
3) Disegnare il circuito equivalente e la caratteristica $I - V$ di una cella solare, determinando graficamente la condizione di carico per la massima potenza in uscita.[3]

SOLUZIONE 3

Si rimanda alla dispensa per la trattazione completa della cella solare, compresa una sezione del dispositivo, da cui è immediato ricavare i passi di processo.

ESERCIZIO 4 (DE) Nel circuito in figura, il transistoro bipolare ha $\beta_f \text{ minimo} = 300$, mentre M_1 e M_2 sono transistori n -MOS con gate in metallo ($N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 0.08 \text{ m}^2/\text{Vs}$, $t_{ox} = 30 \text{ nm}$, $W/L = 20$). Per misurare la tensione di soglia, sono stati caratterizzati con $V_{GS} = 5 \text{ V}$, ottenendo per basse V_{DS} una resistenza di quadro pari a $R_{quadro} = 2600 \Omega$.

1) Determinare la funzione di lavoro del metallo.[4]



2) Calcolare il punto di riposo dei transistori e le correnti nel circuito.[4]

3) Determinare V_u per $V_{S1} = -12 \text{ V}$, verificando la polarizzazione dei transistori.[2]

SOLUZIONE 4

1) Ricordiamo che per piccole V_{DS} e per $W = L$ ($C_{ox} = \epsilon_{ox}/t_{ox} = 1.15 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$):

$$I_{DS} = \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS}$$

$$R_{quadro} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{TH})}$$

$$V_{TH} = V_{GS} - \frac{1}{\mu_n C_{ox} R_{quadro}} = 0.82 \quad \text{V}$$

Quindi avremo:

$$V_{TH} = \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} + 2\psi_B + \Phi_{MS}$$

$$\psi_B = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) = 0.347 \quad \text{V}$$

$$\Phi_{MS} = V_{TH} - \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A 2\psi_B}}{C_{ox}} - 2\psi_B = -0.29 \quad \text{V}$$

$$\Phi_M = \Phi_S - 0.29 = 4.1 + 0.54 + 0.347 - 0.29 = 4.70 \quad \text{V}$$

2) Iniziamo dalla base di Q_1 , $V_B = -4$ V con l'approssimazione di partitore pesante, conseguentemente $V_E = -4.7$ V. L'anodo dello zener si trova ad una tensione pari a $-12 + 3.3 = -8.7$ V, e quindi $I_E = (-4.7 - (-8.7))/1$ k=4 mA. Poichè lo stadio è simmetrico, avremo $I_E \simeq I_C$ $I_{S1} = I_{S2} = I_C/2$. Quindi $V_{GS1} = V_{GS2}$:

$$I_{DS} = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2 L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{2I_{DS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} + V_{TH} = 2.3 \quad \text{V}$$

Quindi $V_{G1} = V_{G2} = 0$ V, $V_{S1} = V_{S2} = V_C = -2.3$ V, $V_{CE} = 2.40$ V. $V_{D1} = V_{D2} = V_{CC} - R_D I_{DS} = 10$ V, $V_{DS1} = V_{DS2} = 10 - (-2.3) = 12.3$ V $>$ $V_{GS} - V_{TH}$. Avremo inoltre $I_{R1} I_{R2} = 12/6 = 2$ mA e $I_{B \max} = I_C / \beta_{f \min} = 13$ μ A, quindi il partitore pesante è verificato. Avremo per i due MOS:

$$I_{DS} = 2 \quad \text{mA}$$

$$V_{GS} = 2.3 \quad \text{V}$$

$$V_{DS} = 12.3 \quad \text{V}$$

E per il bipolare:

$$I_C \simeq I_E = 4 \quad \text{mA}$$

$$\begin{aligned}
I_{B \max} &= \frac{I_C}{\beta_{fmin}} = 13 \quad \mu\text{A} \\
V_{BE} &\simeq V_\gamma = 0.7 \quad \text{V} \\
V_{CE} &= 2.4 \quad \text{V}
\end{aligned}$$

3) Per $V_G = -12 \text{ V}$ il transistoro M_1 è sicuramente interdetto. Se M_1 è interdetto, tutta la corrente I_C scorre in M_2 , e quindi avremo $I_{DS2} = 4 \text{ mA}$ e quindi:

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{2I_{DS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} + V_{TH} = 2.9 \quad \text{V} \quad (5)$$

Avremo dunque che $V_{S2} = V_C = -2.9 \text{ V}$, $V_{CE} = 1.8 \text{ V}$, $V_u = V_{D1} = 8 \text{ V}$, $V_{DS1} = 10.9 \text{ V}$, $> V_{GS1} - V_{TH}$. Quindi i transistori M_2 e Q rimangono polarizzati correttamente (in saturazione il MOS e in zona attiva diretta il bipolare).